Docket No.: GR 97 P 2681 6661 1 0 VOV

Postal S rvice as First Class Mail in an envelope addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231, on the date indicated below. I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States

HA THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

: Albrecht Mayer Inventor

£21,481\60 : .oN .bilggA

Filed

: September 30, 1998

: S. Clark

: Method for Assembling Integrated Circuits With Protection Of **9ltiT**

Of Integrated Circuits With Protection Against Electrostatic The Circuits Against Electrostatic Discharge, And Arragement

Discharge

G18S JinU hA

Examiner

FOR PRIORITY WIA10

Washington, D.C. 20231 Hon. Commissioner of Patents and Trademarks,

SIL

September 30, 1997. 119, based upon the German Patent Application 197 43 344.8, filed Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section

submitted herewith. A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being

LAURENCE A. GREENBERG

BEC' NO: 58'308

Respectfully submitter

Date: October 27, 1999

LERNER AND GREENBERG, P.A.

POST OFFICE BOX 2480

HOLLYWOOD, FL 33022-2480

FAX: (954) 925-1101 TEL: (954) 925-1100

qwq/

• 7

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



PARTITION OF STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Bescheinigung

Die Siemens Aktiengesellschaft in München/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Verfahren zum Verbinden von integrierten Schaltkreisen und Anordnung"

am 30. September 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprüng-lichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig das Symbol H 01 L 23/62 der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 18. Oktober 1999

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

gsriftuA ml

lalofsky

gennA mi

8 77

Aktenzeichen: 197 43 344.8



| <u>.</u> | | |
|----------|--|--|
| | | |

Beschreibung

ς

30

52

Verfahren zum Verbinden von integrierten Schaltkreisen und Anordnung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen integrierten Schaltkreisen mit Schutz gegen elektrostatische Entladungen. Die Erfindung betrifft außerdem eine Anordnung von zwei elektrisch leitend mit einander verbundenen integrierten Schaltkreisen mit Schutz gegen elektrostatische Entladungen.

In elektronischen Systemen besteht Bedarf, zwei oder mehrere integrierte Schaltkreise in einem Gehäuse mit einer Signalverbindung zu versehen, um eine kompakte Anordnung der Schaltchen der Schaltkreise weisen Kontaktlächen, sogenannte Pads, auf, die über Bonddrähte mit Anschlußstiften des Gehäuses, sogenannten Pins, verbunden sind.
Über diese sind die Versorgungsspannung und Signale zuführÜber diese sind die Versorgungsspannung und Signale zuführSchaltkreisen ebenfalls über jeweilige Anschlußpads, die wieschaltkreisen ebenfalls über jeweilige Anschlußpads, die wiederum über Bonddrähte miteinander verbunden sind. Im allgemeinen werden diese internen Signalanschlüsse und Verbindungen nicht aus dem Gehäuse herausgeführt.

Um zu verhindern, daß elektrostatische Ladungen, die mit den äußeren Gehäusepins in Berührung kommen, die schaltkreisinrach außen geführten Pads Schutzstrukturen gegen elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) zugeordnet. Diese Schutzstrukturen dienen als Schalter, die bei einer

Sern die Chipfläche.

30

57

02

SI

OT

S

Überspannung leitend werden und die anliegende elektrostatische Ladung zu einer Leitung für eine der Versorgungsspannungen abführen. Die ESD-Schutzstrukturen beanspruchen nicht unbeträchtliche Schaltungsfläche.

Nach herkömmlicher Technik sind auch für die nur für gehäuseinterne Signalverbindungen vorgesehenen Anschlußpads Schutzstrukturen erforderlich, um elektrostatische Entladungen, die
während der Montage, beispielsweise beim Bonden, auftreten
können, abzuführen. Auch diese ESD-Schutzstrukturen vergrö-

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, Maßnahmen für die elektrische Verbindung zwischen integrierten Schaltkreisen anzugeben, die bei ausreichendem Schutz gegen elektrostatischer Entladung einen geringeren Flächenverbrauch erfordern.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen integrierten Schaltkreisen nach den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst, außerdem durch eine Anordnung von elektrisch leitend miteinander verbundenen integrierten Schaltkreisen nach den Merkmalen des Patentanspruchs 8.

Die Verbindung zwischen dem Signalanschluß und dem Versorgungspotentialanschluß in einem der Schaltkreise ist vorzugsweise eine Leiterbahn aus Metall oder Polysilizium. Sie sorgt daher für eine niederohmige Verbindung zwischen diesen Anschlüssen. Während der Montage sind darüber etwaige ESD-Entladungen abführbar. Nach der Montage, wenn der Signalanschluß von außen nicht mehr zugänglich ist, ist die Verbinschluß von außen nicht mehr zugänglich ist, ist die Verbinschluß von außen nicht mehr zugänglich ist, ist die Verbinschluß von außen nicht mehr zugänglich ist, ist die Verbinschluß von außen nicht mehr zugänglich ist, ist die Verbinschluß von außen nicht mehr zugänglich ist, ist die Verbinschluß von außen nicht mehr zugänglich ist, ist die Verbinschluß

dung überflüssig; sie wird durchtrennt und hat im weiteren keinen Einfluß auf die Signalverarbeitung mehr. Zweckmäßigerweise wird die Metalleiterbahn in der obersten Metallage ausgebildet, die gegebenfalls zusätzlich zu den übrigen Metallage, gen, die die Signalverarbeitung ausführende Schaltungsteile des integrierten Schaltkreises verbinden, aufgebracht ist. Zusätzliche Fläche ist nicht erforderlich.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der in der Zeichnung 0 dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert.

Es zeigen:

20

Eigur 1 eine Aufsicht auf zwei in einem Gehäuse nebeneinStrukturen zum ESD-Schutz und

Figur 2 einen Querschnitt durch eine Anordnung zweier integrierter Schaltungen.

Die in Figur 1 dargestellte Anordnung enthält einen ersten integrierten Schaltkreis 1 und einen zweiten integrierten Schaltkreis 1 und einen zweiten integrierten Schaltkreise sind in einem Gehäuse 3 angeordnet, von dem nur der untere Teil dargestellt ist. Die integrierte Schaltung 1 enthält (nicht dargestellte) Funktinonseinheiten, beispielsweise Transistorschaltungen, denen im Betrieb über die Anschlüsse 15, 16, 17 zu verarbeitende Singnale zugeführt werden. Darüber hinaus sind zum ESD-Schutz gnale zugeführt werden. Darüber hinaus sind zum ESD-Schutz häuse Leiterbahnen 14, 13 vorgesehen, die die Signalanschlüsser 15, 16 bzw. 17 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 17 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 17 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 17 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 17 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 17 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 17 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 17 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 17 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 17 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 11 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 11 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 11 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 11 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 11 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 11 jeweils mit einem Anschluß 10 bzw. 11 verset 15, 16 bzw. 11 verset 15

52 häusepin 4 über einen Bonddraht verbunden. schaltungen mit Masse versorgt, ist ebenfalls mit dem Geverbunden. Ein Anschlußpad 12, das die Signalverarbeitungswher herkömmliche Bonddrähte mit einem Gehäusepin 4 für Masse lich geringeren Querschnitt. Die Anschlußpads 10, 11 sind 20 Vergleich zum übrigen Verlauf der Leiterbahnen einen wesentmit einer Engstelle 143, 144, 131 auf. Diese Stellen haben im angeordnet. Die Leiterbahnen weisen einen kurzen Abschnitt zweckmäßigerweise in tiefergelegenen Verdrahtungsschichten SI gen 13, 14 aus Polysilizium hergestellt werden. Sie sind dann rungsebenen aufgebracht werden. Alternativ können die Leitunlich zu den für die übrige Verdrahtung vorgesehen Metallisieoberste Metallisierungsebene. Diese kann gegebenfalls zusätztallisierungsebene angeordnet. Zweckmäßigerweise ist dies die sistorschaltungen vorgesehenen Metalleiterbahnen in einer Me-OΤ sind zusätzlich zu den ohnehin für die Verdrahtung der Tran-13, 14 bestehen beispielsweise aus Metalleiterbahnen. Diese nungsversorgung des Schaltkreises I benötigt. Die Leitungen Kömmlich vorhanden und werden außerdem für die übliche Span-Ben kontaktiert wird. Die Anschlüsse 10, 11 sind ohnehin hergebildete Gebiete, an denen die integrierte Schaltung von ause 15, 16, 17, 10, 11 sind sogenannte Pads, flächenhaft auskreises, beispielsweise Masse, verbunden ist. Diese Anschlüsbinden, der mit einem der Versorgungspotentiale des Schalt-

Im integrierten Schaltkreis 2 sind Anschlußpads 25, 26, 27

vorgesehen, die über jeweilige Bonddrähte mit den Pads 15, 16

bzw. 17 des Schaltungschips 1 verbunden sind. Ein Anschlußpad

22 ist ebenfalls mit dem Massepin 4 gebondet, um Schaltungen

im Chip 2 an Masse anzuschließen. Die Pads 25, 26 sind über

eine Leitung 24 mit einem Pad 20 verbunden, welches wiederum

le verbindet.

30

52

20

ST

οτ

an einen Außenanschlußpin 5 des Gehäuses gebondet ist. Das pad 27 ist über eine Leitung 23 mit einem anderen Pad 21 verbunden, welches an einen weiteren Gehäusepin 6 gebondet ist.

Zur Entkopplung der Pads 25, 26 untereinander sind zwei Di-oden 241, 242 vorgesehen, über die die Leitung 24 an die Pads 25 bzw. 26 geführt wird. Die Gehäusepins 5, 6 sind - wie unten detaillierter beschrieben - zur Zuführung eines Stromim-pulses vorgesehen und entsprechend dimensioniert, um nach der Montage die Engstellen 143, 144, 131 zu unterbrechen. Da die Gehäuses haben, sind ihnen herkömmliche ESD-Schutzstrukturen Gehäuses haben, sind ihnen herkömmliche ESD-Schutzstrukturen ne Anordnung aus Dotierungsgebieten, die beim Anlegen einer überspannung, z. B. 2000 ... 3000 V, anspricht und den jewei-ligen Anschluß niederohmig mit einem der Versorgungspotentia-

Der ESD-Schutz der Anschlüsse 15, 16, 17 durch die Leiterbahnen 14, 13 bei der Montage der integrierten Schaltungen 1, 2
im Gehäuse 3 wird wie folgt gewährleistet. Die integrierten
Schaltkreise 1, 2 werden im Montageautomaten zuerst auf einem
Leadframe aufgebracht und anschließend untereinander und mit
den Gehäusepins durch Bonddrähte verbunden. Während dieser
phase sind die Anschlüsse 15, 16, 17 aufgrund von möglicher
drähte ESD-gefährdet. Etwaige ESD-Ladungen werden über die
drähte ESD-gefährdet. Etwaige ESD-Ladungen werden über die
niederohmigen Verbindungen 13, 14 zu den Masseanschlüssen 10,
niederohmigen Verbindungen 13, 14 zu den Masseanschlüssen 10,
auch intern elektrische miteinander verbunden. Nachdem das
such intern elektrische miteinander verbunden. Nachdem das
15, 16, 17 nicht mehr berührt werden können, werden die Eng15, 16, 17 nicht mehr berührt werden können, werden die Eng-

30

52

20

SI

OΤ

stellen 143, 144, 131 durchtrennt. Dies erfolgt durch einen ausreichend langen und kräftigen Stromimpuls, der so eingestellt ist, daß die Engstellen verdampfen und die Leitungen 13, 14 an dieser Stelle unterbrochen werden. Die Engstellen einer Schmelzsicherung. Der Stromimpuls wird von außen über die Anschlußpins 5, 6 eingeprägt und über die jengerligen Anschlüßpins 5, 8 eingeprägten Anschlüßpins 5 weitergeleitet. Während des normalen Funktionseinsatzes der Schaltung 1 werden durch Funktionseinheiten Pads 15, 16, 17 angeordnet, so daß diese möglichst wenig mit pads 15, 16, 17 angeordnet, so daß diese möglichst wenig mit patssitären Kapazitäten belastet werden.

Bondung zum Schaltungschip 1 die Pads 15, 16, 17 mit diesen 211 versehen werden. Auch dann sind bereits nach vollzogener mit einer ESD-Schutzstruktur entsprechend den Strukturen 201, können auch die Pads 25, 26 und gegebenenfalls auch Pad 27 den Stromimpuls entfällt dann. In Weiterbildung der Erfindung B. durch einen Laserstrahl, erfolgen. Der Anschlußpin 6 für auch durch andere Maßnahmen, die Energieimpulse erzeugen, z. noch geöffnet ist, kann das Durchtrennen der Engstelle 131 struktur 211 verbunden ist. Da in diesem Fall das Gehäuse über den Bonddraht zum Pad 27 leitend mit der ESD-Schutz-I7 möglich ist, durchtrennt werden, da bereits das Pad 17 des Gehäuses, wenn noch ESD-gefährdeter Außenkontakt des Pads der Pads 17, 27, aber noch vor dem vollständigen Schließen her kann die Engstelle 131 nach bereits vollzogener Bondung 21 und der zugehörigen ESD-Schutzstruktur 211 verbunden. Da-Das Pad 27 ist unmittelbar über die Leiterbahn 23 mit dem Pad

S

jeweiligen ESD-Schutzstrukturen unmittelbar über die Bonddrähte verbunden. Die Stromimpulspins 5, 6 können entfallen. Die Engstellen sind durch entsprechende Stromeinprägung in die Pads 15, 16, 17 bei geöffnetem Gehäuse oder durch einen

Die Querschnitte der Engstellen 143, 144,131 weisen eine Querschnittsfläche von ungefähr 0,4 ... 1,0 µm² auf. Am unteren Ende dieses Bereichs liegt eine ESD-Festigkeit von ca.

250 ... 350 V vor, was für die Montage ausreicht. Durch einen Strom von ca. 12 mA kann die Engstelle durchschmolzen werden.

Der übrige Teil der Leiterbahn weist eine um eine Größenordnung höhere Querschnittsfläche auf.

Lötwarzen 71, 72 gebildeten Abstand aufweisen, ist es nicht verbunden. Auch wenn die Chips 7, 8 einen geringen, durch die 30 Pad 74 über die Lötwarze 71 und die Leitung 84 mit dem Pad 82 pad 81 im Chip 8 verbunden. In entsprechender Weise wird das Lötwarze 72 sowie die Verbindungsleitung 83 mit dem Anschlußangelehnt. Dadurch wird das Anschlußpad 73 im Chip 7 über die se Technik ist an die sogenannte Flip-Chip-Verbindungstechnik 52 Verbindung mit leitfähigem Klebematerial bewirkt werden. Diedurch Kontaktwarzen 71, 72 hergestellt. Alternativ kann eine drähten hergestellt wird, wird in der Ausführung der Figur 2 Kontakt, der bei der Ausführung nach Figur 1 mittels Bondganglich sind, miteinander in Verbindung. Der elektrische 20 richtet und folglich auch die entsprechenden Anschlußpads zuweiligen Oberfläche, zu denen die aktiven Elemente hin geschip 7 und ein zweiter Schaltungschip 8 stehen an ihrer jedem in Figur 2 dargestellten Beispiel. Ein erster Schaltung-Das Verfahren und die Anordnung sind besonders vorteilhaft in SI

OI

74, 75 an der Stelle 79 durchtrennt. sprechender Weise wird die Verbindung 78 zwischen den Pads 77 durch eine Stromeinprägung am Pad 81 durchtrennt. In entund dem Massepad 75 wird daher anschließend an der Engstelle ESD-gefährdet. Die Verbindung 76 zwischen dem Signalpad 73 ander gebracht worden sind, sind die Pads 73, 74 nicht mehr langen. Sobald die Chips 7, 8 räumlich wie dargestellt zueinmöglich, mit mechanischen Mitteln an die Pads 73, 74 zu ge-

wirksam ESD-geachützt. sätzlichen Pads angeschlossen sind, sind während der Montage geschützt gebildet. Die Schaltungseinheiten, die an die zudie Leiterbahnen 13, 14 bzw. 76, 78 gebildet werden, ESD-Diese Pads werden in der zusätzlichen Metallage, in der auch 02 Signale über den Chip 2 bzw. 8 nach außen geführt werden. Serienversion hinausgehenden Anschlußpads, über die interne bzw. 73, 74 des Microcontrollers sind zusätzliche, über seine Microcontrollers gebildet wird. Die Anschlußpads 15, 16, 17 nung der Chips eine In-Circuit-Emulation-(ICE-)Anordnung des liche Schaltungsmittel enthält, so daß aus der Gesamtanordeinem Chip 2 bzw. 8 in Kontakt gebracht wird, welcher zusätz-Microcontroller herkömmlicher Massenfertigung ist, der mit vorteilhaft anwendbar, wenn der Schaltungschip 1 bzw. 7 ein Das beschriebene Verfahren und die Anordnung sind besonders

Patentansprüche

terbrochen wird.

20

SI

OT.

1. Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Verbindung
zwischen integrierten Schaltkreisen mit den Merkmalen:

- Vorsehen eines ersten integrierten Schaltkreises (1; 7) mit
signalanschluß (15, 17) für ein Versorgungspotential, einem
Signalanschluß (15, 17) für die Verbindung mit einem zweiten integrierten Schaltkreis (2; 8) und einer elektrisch
leitenden Verbindung (14, 13) zwischen dem Anschluß für das
Jeitenden Verbindung (14, 13) zwischen dem Anschluß für das
Versorgungspotential (10, 11) und dem Signalanschluß (15,

- Vorsehen eines zweiten integrierten Schaltkreises (2) mit einem Anschluß (20, 21), der mit einer Schutzstruktur (201, 211) gegen elektrostatische Entladungen gekoppelt ist, benachbartes Anordnen der integrierten Schaltkreise (1, 2), - elektrisch leitendes Verbinden des Signalanschlusses (15, 17) des ersten integrierten Schaltkreises (15, 2), gchjuß (20, 21) des zweiten integrierten Schaltkreises (2),

(10, 11; 15, 17) des ersten integrierten Schaltkreises (1) durch einen Energieimpuls.

- (Trennen der Verbindung (14, 13) zwischen den Anschlüssen

2. Verfahren nach Anapruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

25 die Verbindung (14, 13) zwischen den Anschlüssen des ersten
integrierten Schaltkreises (1) einen Abschnitt (143, 131) mit
verringerter Querschnittsfläche aufweist, der derart bemessen
ist, daß er elektrostatische Entladungen zwischen den Anschlüssen (10, 11; 15, 17) des ersten integrierten Schaltschlüssen (10, 11; 15, 17) des ersten integrierten Schaltschlüssen (10, 11; 15, 17) des ersten integrierten Schalt-

30 dadurch nach Anspruch 5, daß

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

20 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

der erste integrierte Schaltkreis (7) mit derjenigen Oberflä
che, an der die Anschlüsse (73, 75, 74) zugänglich sind, auf

derjenigen Oberfläche des zweiten integrierten Schaltkreises

(8), an der der Anschluß (81, 82) des zweiten integrierten

Anschluß (81, 82) des zweiten integrierten

Anschluß (81, 82) des zweiten integrierten

vom ersten integrierten Schaltkreises (8)

vom ersten integrierten Schaltkreis (8)

4. Verfahren nach einem der Ansprüche I bis 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
geordnet werden Schaltkreisee (1, 2) in einem Gehäuse (3) anersten integrierten Schaltkreises (1) von außerhalb des Gehäuses (3) nach der Anordnung in demselben nicht zugänglich
ist, und daß der Anordnung in demselben nicht zugänglich
tist, und daß der Anschluß (10, 11) für das Versorgungspotenist, und daß der Anschluß (10, 11) für das Versorgungspotentist, und daß der Anschluß (20, 11) für das Versorgungspotenschlußpin (4; 5, 6) des Gehäuses kontaktiert werden.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, daß da urch gekennitt (143, 131) durch einen eingeprägten Stromimpuls, der am Anschluß (20, 21) des zweiten integrierten Schaltkreises (2) zugeführt wird, unterbrochen wird.

71) oder einem leitfähigen Klebematerial verbunden werden. ten Schaltkreises (8) mittels einem lötbaren Material (72, kreises (7) und der Anschluß (81, 82) des zweiten integrierder Signalanschluß (73, 74) des ersten integrierten Schalt-

mehr mechanisch zugänglich ist. (15, 17; 73, 74) des ersten integrierten Schaltkreises nicht der Energieimpuls eingeprägt wird, nachdem der Signalanschluß dekennzeichnet, gagnzcp 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

integrierten Schaltkreisen umfassend: 8. Anordnung von elektrisch leitend miteinander verbundenen

- einen ersten integrierten Schaltkreis (1; 7), der einen An-

flache aufweist, und nen Abschnitt (143, 131) mit verringerter Querschnittsbindung (14, 13) zwischen den Anschlüssen aufweist, die eischluß (10, 11) für ein Versorgungspotential, einen Versorgungspotentisch leitende Vert

ses (1) und dem Anschluß (20, 21) des zweiten integrierten Signalanschluß (15, 17) des ersten integrierten Schaltkreielektrisch leitende Verbindung (24, 23) zwischen dem deden elektrostatische Entladung versehen ist, und eine Anschluß (20, 21), der mit einer Schutzstruktur (20, 21) - einen zweiten integrierten Schaltkreis (2; 8), der einen

daß der Abschnitt (143, 131) derart bemessen ist, daß er 30 dekennzeichnet, дэдпрер 9. Anordanng nach Anspruch 8,

Schaltkreises (2) aufweist.

52

20

SI

S

elektrostatische Entladungen zwischen den Anschlüssen (10,

OT

(241, 242) verbunden sind.

5 10. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 oder 9, daß daur ch gekenn Schaltkreis (1) weitere Signalanschlüsse (16) angeordnet sind, die mit dem Anschluß (20) des zweiten integrierten Schaltkreises (2) jeweils über Dioden

Parammentsus

Verfahren zum Verbinden von integrierten Schaltkreisen und Anordnung

Bei einem ESD-geschützten Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen integrierten Schaltkreisen (1, 2) wird im ersten Schaltkreis (1) eine niederohmige Verbindung (14, 13) zwischen einem Signalpad (15, 16, 17) und einem Pad (10, 11) für ein Versorgungspotential hergestellt. Die Verbindung weist einen Abschnitt (143, 144, 131) verringerten Querschnitts auf, der nach Montage und Bondverbindung mit dem zweiten Schaltkreis (2) durch einen Stromimpuls durchtrennt wird. Der ESD-Schutz während der Montage benötigt

Figur 1

SI

OΤ

S

keine zusätzliche Chipfläche.

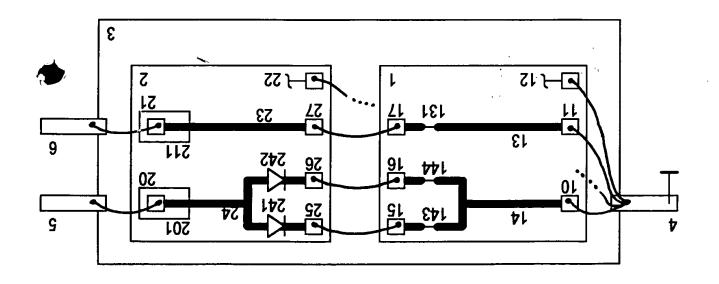


FIG. 1

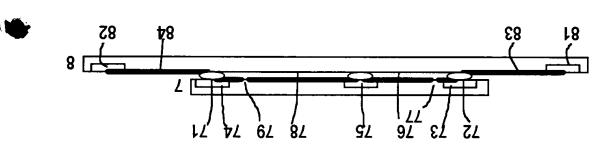
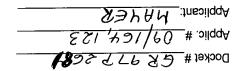


FIG. 2



Lerner and Greenberg, P.A.
Post Offlice Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101